

# 國立交通大學

電子工程學系

電子研究所碩士班

碩士論文

基板的電漿處理對銅化學氣相沉積特性之影響



**Effects of Plasma Substrate Treatment  
on Cu-CVD**

研究生：楊宇國

指導教授：陳茂傑

中華民國九十三年六月

基板的電漿處理對銅化學氣相沉積特性之影響

Effects of Plasma Substrate Treatment  
on Cu-CVD

研 究 生：楊宇國

Student : Yu-Kao Yang

指 導 教 授：陳茂傑

Advisor : Mao-Chieh Chen

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班



A Thesis

Submitted to Institute of Electronics  
College of Electrical Engineering and Computer Science  
National Chiao Tung University  
In Partial Fulfillment of the Requirement  
For the Degree of  
Master of Science

In

Electronic Engineering

June 2004

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年六月